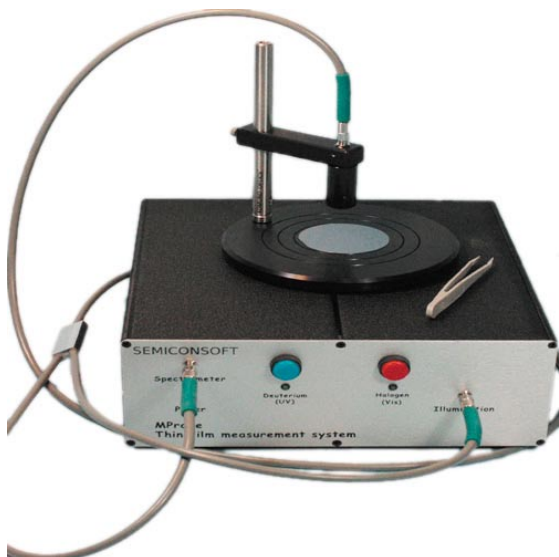


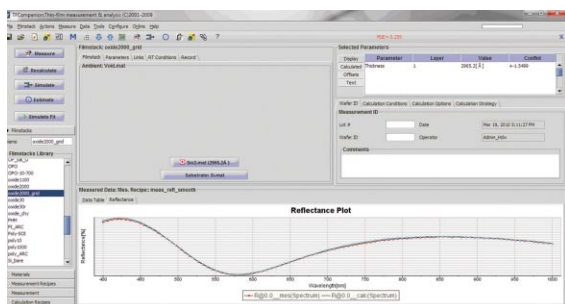
# 膜厚測定装置 MProbeシリーズ



MProbe20シリーズは、分光反射率法に基づいた薄膜の膜厚測定のためのデスクトップシステムです。システムには、本体（分光器、光源、検出器を内蔵）、光ファイバプローブ、試料ステージ、解析ソフトウェア、キャリブレーションサンプルが含まれており、すぐに測定を開始できます。また、SemiconSoft社のライブラリーには500種類以上の材料が登録されており、新規登録も非常に簡単です。



● MProbe20-UVVis



● TFCompanion (解析ソフトウェア)

## アプリケーション

酸化シリコン、窒化シリコン、DLC、フォトレジスト、ポリマー、ポリアミド、ポリシリコン、ナノクリスタルシリコン、アモルファスシリコン、シリコン、バリレンなどの半透明または低吸光性のフィルムの膜厚測定（膜厚：1nm～1,000 μm）

## 薄膜太陽電池

アモルファスシリコン、CIGS、CdTe、TCO

## 半導体および誘電材料

フォトレジスト、酸化物、窒化物、OLED積層体

## 光学コーティング

反射防止コート、ハードコート、フィルター

## 液晶ディスプレイ

セルギャップ、ITO、ポリアミド

## その他

磁気メディア、レーザーミラー、金属薄膜

## 特長

- 膜厚、光学定数、表面粗さ等を非破壊で測定可能
- 用途に合わせた柔軟なシステム構成
- 0.01nmまたは0.01%以下の優れた精度
- ユーザーフレンドリーかつ強力な解析ソフトウェア
- 500種類以上の材料を含むライブラリー

## 本体仕様

型式	MProbe20-Vis	MProbe20-UVVisSR	MProbe20-HRVis	MProbe20-NIR	MProbe20-VisNR	MProbe20-UVVisNIR	MProbe20-UVVis-RT	MProbe20-UVVisNIR-RT
測定膜厚範囲	10nm～75 μm	1nm～50 μm	1 μm～300 μm	100nm～100 μm	10nm～200 μm	1nm～200 μm	1nm～50 μm	1nm～200 μm
波長	400～1100 nm	200～1100 nm	700～1000 nm	900～1700 nm	400～1700 nm	200～1700 nm	200～1000 nm	200～1700 nm
検出器	CCD, 3600 px	CCD, 2048 px	CCD, 2048 px	InGaAs PDA, 512 px	InGaAs PDA, 512 px / CCD, 3600 px	InGaAs PDA, 512 px / CCD, 2048 px	CCD, 2048 px	InGaAs PDA, 512 px / CCD, 2048 px
光源	5W TH	20W TH / 30W D2	5W TH	5W TH	5W TH	5W TH / 30W D2	20W TH / 30W D2	5W TH / 30W D2
精度	0.01 nmまたは0.01%未満 *100nm SiO <sub>2</sub> /Siキャリブレーションサンプル測定時							
確度	1 nmまたは0.2%未満 *膜組成による							
安定性	0.02 nmまたは0.02%未満							
測定スポットサイズ	[標準] 2 mm / [オプション] 0.5 mm							
サンプルサイズ	5 x 5 mm～200 x 200 mm						5 x 5 mm～120 x 120 mm	

\* 価格はお問い合わせください。